Partial Translation of JP 2000-159840

Publication Date: June 13, 2000

Application No.: 1998-336193

Filing Date: November 26, 1998

Applicant: KONISHIROKU PHOTO IND

Inventor: Hideyuki NAKAI

Inventor: Nobuyuki TAKIYAMA

Inventor: Toru KOBAYASHI

Inventor: Mitsuyo HASEGAWA

# [0078]

Next, the following composition B for an intermediate refractive index layer was coated on the hard-coated layer 6, and dried for 30 minutes at 80°C. Subsequently, it was irradiated with light of 3 kw of a high-pressure mercury vapor lamp for 10 seconds at a distance 25 cm apart from, and hardened, thus an intermediate refractive index layer 7 was provided. In addition, the thickness of the intermediate refractive index layer 7 was 80 nm and the refractive index of the intermediate refractive index layer 7 was 1.66.

[Composition B for an intermediate refractive-index layer]

titanium-tetra-n-butoxide 30 weight part

diethoxy-benzophenone UV-initiator 0.1 weight part

γ·methacryloxy·propyltrimethoxy·silane 5 weight part

cyclohexanone 1400 weight part

isopropyl-alcohol 3500 weight part

Next, the following composition C for a high refractive-index layer was coated on the intermediate refractive-index layer 7, and dried for 5 minutes at 80°C. Subsequently, it was irradiated with light of 3 kw of the high-pressure mercury-vapor lamp for 10 seconds at a distance 25 cm apart from, and hardened, thus a high refractive-index layer 8 was provided. In addition, the thickness of the high refractive-index layer 8 was 85 nm and the refractive index of the high refractive-index layer 8 was 1.90. [0079]

[Composition C for a high refractive-index layer]

titanium-tetra-n-butoxide

75 weight part

tetra-ethoxy-silane

8.3 weight part

surfactant

1 weight part

(F-177 made by Dainippon Ink and Chemicals, Incorporated)

cyclohexanone

2500 weight part

toluene

5700 weight part

After that, the following composition D containing fluoromonomers was coated on the high refractive-index layer 8, and dried for 2 minutes at 80°C. Subsequently, it was irradiated with light of a high-pressure mercury-vapor lamp for 10 seconds from a distance of 25 cm apart from, and hardened, thus, a low refractive-index layer 9 was provided. In addition, the thickness of the low refractive-index layer 9 was 90 nm and the refractive index of the low refractive-index layer 9 was 1.37.

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-159840 (P2000-159840A)

(43)公開日 平成12年6月13日(2000.6.13)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号		FΙ				デーマコート*(参考)
COSF 220/24	1		C 0 8	F 220/24			2H049
B 3 2 B 7/02	103		B 3 2	B 7/02		103	2 K O O 9
27/30	)			27/30		D	4 F 1 0 0
COSF 2/48	3		C 0 8	F 2/48			4 J O 1 1
220/20	)			220/20			4 J 1 0 0
		審查請求	未請求	請求項の数11	OL	(全 17 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特顏平10-336193

(22)出願日

平成10年11月26日(1998.11.26)

(71)出願人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72)発明者 中井 英之

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式

会社内

(72)発明者 滝山 信行

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式

会社内

(74)代理人 100079005

弁理士 宇高 克己

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 反射防止剤、反射防止材、偏光板保護フィルム、及び偏光板

### (57)【要約】

(修正有)

【課題】 表面硬度が高く、傷付きが起き難く、耐久性に富み、更には反射率が低く、外光の映り込みが防止され、その結果、視野角も拡がり、そして光透過率も高く、又、透明基材に対する密着性が高いこと、かつ、造膜性に優れている材料を提供する。

【解決手段】 一般式 [I], [II], [III], [IV], [V]で表される含フッ素モノマーを二種類以上含み、このうちの少なくとも二種類の含フッ素モノマーは一般式 [I], [II], [III], [IV], [V]の異なる群の中から選ばれたものであることを特徴とする反射防止剤。

一般式〔1〕

 $C H_z = C X_1 - C O O R f$ 

一般式〔11〕

 $YOOC-CH=CX_1-COOZ$ 

一般式〔ІІІ]

CH₂=C-COOY

CH<sub>2</sub>COOZ

一般式〔IV〕

COOZ

一般式〔V〕 CH2=CX1-C00-CHCH2-OOC-CX2=CH2 | Rf 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式[I], [II], [III], [IV], [V]で表される含フッ素モノマーを二種類以上含み、このうちの少なくとも二種類の含フッ素モノマーは一般式[I], [III], [IV], [V]の異なる群の中から選ばれたものであることを特徴とする反射防止剤。

1

一般式〔1〕

 $C H_2 = C X_1 - C O O R f$ 

[X<sub>1</sub> は、水素原子、又はメチル基。 Rf は、フッ素原 10 子を3個以上有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を4個以上有する炭素数4~12のシクロアルキル基。]

一般式〔11〕

 $YOOC-CH=CX_1-COOZ$ 

[X<sub>1</sub> は、水素原子、又はメチル基。 Y 及び Z は、炭素数 2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、炭素数 4~12のシクロアルキル基、フッ素原子を有する炭素数 2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数 4~12のシクロアルキル基。 Y 及び Z は、同一であっても異なっていてもよい。但し、 Y 及び Z の少なくとも一方の基はフッ素原子を含む。〕

一般式〔III〕

【化1】

[Y及びZは、炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、炭素数4~12のシクロアルキル基、フッ素原子を有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数4~12のシクロアルキル基。Y及びZは、同一であっても異なっていてもよい。但し、Y及びZの少なくとも一方の基はフッ素原子を含む。]

一般式〔IV〕

【化2】

〔Y及びZは、炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、炭素数4~12のシクロアルキル基、フッ素原子を有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数4~12のシクロアルキル基。Y及びZは、同一であっても異なっていてもよい。但し、Y及びZの少なくとも一方の基はフッ素原子を含む。〕

一般式〔V〕

【化3】

 $[X_1]$  及び $X_2$  は、水素原子、又はメチル基。 $X_1$  及び $X_2$  は、同一であっても異なっていてもよい。 $R_1$  は、フッ素原子を3個以上有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を4個以上有する炭素数4~12のシクロアルキル基。]

【請求項2】 一般式[I], [II], [III], [III], [IV] の群の中から選ばれた少なくとも一つの含フッ素モノマーと、

一般式 [V] の群の中から選ばれた少なくとも一つの含フッ素モノマーとを含むことを特徴とする反射防止剤。 一般式 [I]

 $CH_2 = CX_1 - COORf$ 

 $[X_1]$  は、水素原子、又はメチル基。Rf は、フッ素原子を3個以上有する炭素数  $2\sim1$  2の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を4個以上有する炭素数  $4\sim1$  2のシクロアルキル基。]

20 一般式[]]

 $YOOC-CH=CX_1-COOZ$ 

[X」は、水素原子、又はメチル基。 Y及び Z は、炭素数 2~1 2の直鎖又は分岐型のアルキル基、炭素数 4~1 2のシクロアルキル基、フッ素原子を有する炭素数 2~1 2の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数 4~1 2のシクロアルキル基。 Y及び Z は、同一であっても異なっていてもよい。但し、 Y及び Z の少なくとも一方の基はフッ素原子を含む。〕

一般式〔ⅠⅠⅠ〕

【化4】



「Y及びZは、炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、炭素数4~12のシクロアルキル基、フッ素原子を有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数4~12のシクロアルキル基。Y及びZは、同一であっても異なっていてもよい。但し、Y及びZの少なくとも一方の基はフッ素原40子を含む。〕

一般式〔1 V〕

【化5】

「Y及びZは、炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、炭素数4~12のシクロアルキル基、フッ素原子を有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数4~12のシクロア ルキル基。Y及びZは、同一であっても異なっていても

よい。但し、Y及び2の少なくとも一方の基はフッ素原 子を含む。〕

一般式〔V〕

【化6】

[X:及びX:は、水素原子、又はメチル基。X:及び X<sub>2</sub> は、同一であっても異なっていてもよい。 Rf は、 フッ素原子を3個以上有する炭素数2~12の直鎖又は 10 分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を4個以上有する 炭素数4~12のシクロアルキル基。〕

【請求項3】 含フッ素モノマーは、該含フッ素モノマ ー中に含まれるフッ素原子が重量比で30~90wt% のものであることを特徴とする請求項1又は請求項2の 反射防止剤。

【請求項4】 透明基材に反射防止層が設けられた反射 防止材であって、

前記反射防止層は、請求項1~請求項3いずれかの反射 防止剤を用いて構成されてなることを特徴とする反射防 20 止材。

【請求項5】 透明基材に反射防止層が設けられ、前記 透明基材と反射防止層との間に該反射防止層の屈折率よ りも高い屈折率の層が設けられた反射防止材であって、 前記反射防止層は、請求項1~請求項3いずれかの反射 防止剤を用いて構成されてなることを特徴とする反射防

【請求項6】 透明基材に反射防止層が設けられ、前記 透明基材と反射防止層との間に該反射防止層の屈折率よ りも高い屈折率の高屈折率層が設けられ、前記透明基材 と高屈折率層との間に該反射防止層の屈折率よりも高い が高屈折率層の屈折率よりも低い屈折率の中屈折率層が 設けられた反射防止材であって、

前記反射防止層は、請求項1~請求項3いずれかの反射 防止剤を用いて構成されてなることを特徴とする反射防 止材。

【請求項7】 透明基材と反射防止層との間に設けられ る層は、金属アルコキシド又はその加水分解物を主成分 としたものを用いて構成されたものであることを特徴と する請求項5又は請求項6の反射防止材。

【請求項8】 反射防止層は、更に光重合モノマーを用 いて構成されてなることを特徴とする請求項4~請求項 7いずれかの反射防止材。

【請求項9】 透明基材がセルロースの低級脂肪酸エス テル及び一軸延伸ポリエチレンテレフタレートの群の中 から選ばれる材料で構成されたものであることを特徴と する請求項4~請求項8いずれかの反射防止材。

【請求項10】 請求項4~請求項9いずれかの反射防 止材で構成されてなることを特徴とする偏光板保護フィ ルム。

【請求項11】 請求項4~請求項9いずれかの反射防 止材で構成されてなるフィルムが偏光子に貼り合わされ てなることを特徴とする偏光板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば液晶表示装 置の偏光板の偏光板保護フィルムとして好適な反射防止 フィルムに関するものである。

[0002]

【従来技術、及び発明が解決しようとする課題】液晶表 示装置(LCD)は、低電圧、低消費電力で、IC回路 への直結が可能であり、そして、特に、薄型化が可能で あることから、ワードプロセッサやパーソナルコンピュ ータ等の表示装置として広く採用されている。このLC Dは、基本的な構成は、例えば液晶セルの両側に偏光板 を設けたものである。

【0003】ところで、偏光板は、一定方向の偏波面の 光だけを通すものである。従って、LCDにおいては、 電界による液晶の配向の変化を可視化させる重要な役割 を担っている。すなわち、偏光板の性能によってLCD の性能が大きく左右される。偏光板の一般的な構成を、 図1に示す。図1中、1は偏光子であり、この偏光子1 の両側に偏光板保護フィルム2が積層されている。この ような構成の偏光板を液晶セルに対して積層すること で、LCDが構成される。

【0004】前記偏光子は、ヨウ素などを高分子フィル ムに吸着・延伸したものである。すなわち、二色性物質 (ヨウ素)を含むHインキと呼ばれる溶液を、ポリビニ ルアルコールのフィルムに湿式吸着させた後、このフィ ルムを一軸延伸することにより、二色性物質を一方向に 配向させたものである。前記偏光板保護フィルムは、耐 久性を向上させる目的から設けられる。

【0005】従って、耐久性に富むこと、例えば表面硬 度が高く、傷付きが起き難いことが望まれる。更には、 外光の映り込みを防止する為、反射率が低いことが望ま れる。又、透明基材に対する密着性が高いこと、かつ、 造膜性に優れていることも要求されている。

【0006】尚、従来、偏光板保護フィルムとしては、 セルロース樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアリレー ト樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹 脂、ノルボルネン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアクリ レート樹脂、ポリエステル樹脂等が提案されていた。し かし、これまでの提案になる偏光板保護フィルムでは、 上記観点からすると、満足出来ないものであった。

【0007】従って、本発明が解決しようとする課題 は、表面硬度が高く、傷付きが起き難く、耐久性に富 み、更には反射率が低く、外光の映り込みが防止され、 その結果、視野角も拡がり、そして光透過率も高く、 又、透明基材に対する密着性が高いこと、かつ、造膜性 50 に優れている材料を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者による偏光板保護フィルムについての研究が鋭意押し進めているうちに、下記の一般式[I], [II], [III], [IV], [V]で表される含フッ素モノマーを二種類以上含み、このうちの少なくとも二種類の含フッ素モノマーは一般式[I], [II], [IV],

【V】の異なる群の中から選ばれたものである場合、特に、下記の一般式〔1〕, 〔11〕, 〔111〕, 〔1 V〕の群の中から選ばれた少なくとも一つの合フッ素モノマーと、下記の一般式〔V〕の群の中から選ばれた少なくとも一つの合フッ素モノマーとを含む反射防止剤を用いて構成されてなる反射防止層を有する材料は、表面硬度が高く、傷付きが起き難く、耐久性に富み、更には反射率が低く、これを偏光板保護フィルムとして用いた偏光板が採用されたLCDは外光の映り込みが防止され、その結果、視野角も拡がり、そして光透過率も高く、又、透明基材に対する密着性が高いこと、かつ、造膜性に優れていることを見出すに至った。

一般式〔I〕

 $CH_2 = CX_1 - COORf$ 

[X」は、水素原子、又はメチル基。

【0009】Rf は、フッ素原子を3個以上有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を4個以上有する炭素数4~12のシクロアルキル基。〕

一般式〔11〕

 $YOOC-CH=CX_1-COOZ$ 

[X」は、水素原子、又はメチル基。

【0010】Y及びZは、炭素数2~12の直鎖又は分 30 岐型のアルキル基、炭素数4~12のシクロアルキル 基、フッ素原子を有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数4~12のシクロアルキル基。Y及びZは、同一であっても異なっていてもよい。但し、Y及びZの少なくとも一方の 基はフッ素原子を含む。〕

一般式〔 [ ] [ ]

[0011]

【化7】

CH2=C-C00Y | CH2C00Z

【0012】 (Y及びZは、炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、炭素数4~12のシクロアルキル基、フッ素原子を有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数4~12のシクロアルキル基。Y及びZは、同一であっても異なっていてもよい。但し、Y及びZの少なくとも一方の基はフッ素原子を含む。)

一般式[IV]

【0013】 【化8】

COOY

【0014】 (Y及びZは、炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、炭素数4~12のシクロアルキル基、フッ素原子を有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を有する炭素数4~12のシクロアルキル基。Y及びZは、同一であっても異なっていてもよい。但し、Y及びZの少なくとも一方の基はフッ素原子を含む。)

一般式 [V]

[0015]

によって解決される。

【化9】

CH2=CX1-C00-CHCH2-00C-CX2=CH2 | | Rf

【0016】 [X1及びX2は、水素原子、又はメチル20 基。X1及びX2は、同一であっても異なっていてもよい。Rfは、フッ素原子を3個以上有する炭素数2~12の直鎖又は分岐型のアルキル基、又はフッ素原子を4個以上有する炭素数4~12のシクロアルキル基。] 上記知見に基づいて本発明がなされたものである。

【0017】すなわち、前記課題は、上記一般式 [I], [II], [II], [IV], [V]で表 される含フッ素モノマーを二種類以上含み、このうちの 少なくとも二種類の含フッ素モノマーは一般式 [I], [II], [II], [IV], [V]の異なる群の 中から選ばれたものであることを特徴とする反射防止剤

【0018】特に、上記一般式〔I〕, 〔II〕, 〔II〕, 〔II〕, 〔IV〕の群の中から選ばれた少なくとも一つの含フッ素モノマーと、上記一般式〔V〕の群の中から選ばれた少なくとも一つの含フッ素モノマーとを含むことを特徴とする反射防止剤によって解決される。又、前記課題は、透明基材に反射防止層が設けられた反射防止材であって、前記反射防止層は、上記反射防止剤を用いて構成されてなることを特徴とする反射防止材によって40解決される。

【0019】又、透明基材に反射防止層が設けられ、前記透明基材と反射防止層との間に該反射防止層の屈折率よりも高い屈折率の層が設けられた反射防止材であって、前記反射防止層は、上記反射防止剤を用いて構成されてなることを特徴とする反射防止材によって解決される。又、透明基材に反射防止層が設けられ、前記透明基材と反射防止層との間に該反射防止層の屈折率よりも高い屈折率の高屈折率層が設けられ、前記透明基材と高屈折率層との間に該反射防止層の屈折率よりも高いが高屈50 折率層の屈折率よりも低い屈折率の中屈折率層が設けら

れた反射防止材であって、前記反射防止層は、上記反射 防止剤を用いて構成されてなることを特徴とする反射防

止材によって解決される。 【0020】又、前記課題は、上記反射防止材で構成さ れてなることを特徴とする偏光板保護フィルムによって 解決される。又、前記課題は、上記反射防止材で構成さ れてなるフィルムが偏光子に貼り合わされてなることを 特徴とする偏光板によって解決される。本発明におい て、一般式[1], [11], [111], [1V], (V)で表される含フッ素モノマーを二種類以上含み、 このうちの少なくとも二種類の含フッ素モノマーは一般 式(I), (II), (III), (IV), (V)の 異なる群の中から選ばれたもの、特に、一般式〔1〕, [11], [11], [1V]の群の中から選ばれた 少なくとも一つの含フッ素モノマーと、一般式 [V] の 群の中から選ばれた少なくとも一つの含フッ素モノマー とを用いるようにしたのは、例えば一般式〔Ⅰ〕のみの 中から選ばれた含フッ素モノマーのみを用いた場合、一 般式〔11〕のみの中から選ばれた含フッ素モノマーの みを用いた場合、一般式〔 I I I 〕のみの中から選ばれ 20 た含フッ素モノマーのみを用いた場合、一般式〔IV〕 のみの中から選ばれた含フッ素モノマーのみを用いた場 合、或いは一般式〔V〕のみの中から選ばれた含フッ素 モノマーのみを用いた場合、傷が付き易く、又、密着性 にも劣り、更には支持体フィルムへの塗布時に塗布面が 不均一になり易く、塗布性に劣り、かつ、塗布欠陥の発 生が頻繁であったのに対して、本発明の組み合わせにな る含フッ素モノマーを用いた場合には、前記の欠点が大

【0021】ここで注目すべきことは、例えば一般式 [1] の中から選んだ含フッ素モノマーを二種以上用い ても、又、一般式〔ⅠⅠ〕の中から選んだ含フッ素モノ マーを二種以上用いても、又、一般式〔ⅠⅠⅠ〕の中か ら選んだ含フッ素モノマーを二種以上用いても、又、一 般式〔IV〕の中から選んだ含フッ素モノマーを二種以 上用いても、又、一般式〔V〕の中から選んだ含フッ素 モノマーを二種以上用いても、本願発明が奏する特長は 得られなかったことである。

幅に解決されたからである。

【0022】上記本発明の反射防止剤における含フッ素 モノマーは、該含フッ素モノマー中に含まれるフッ素原 40 子が重量比で30~90wt%(特に、40wt%以 上。80wt%以下。)のものが好ましい。すなわち、 含フッ素量が30wt%未満の少ない場合には、屈折率 が大きくなる傾向があり、逆に、含フッ素量が90wt %を越えて多い場合には、塗膜強度が劣化の傾向がある からである。

【0023】上記本発明における反射防止層は、上記し た含フッ素モノマーの他に、光重合モノマーをも用いて 構成されてなるものが好ましい。すなわち、光重合モノ

難くなるからである。上記本発明における透明基材は、 セルロースの低級脂肪酸エステル及び一軸延伸ポリエチ レンテレフタレートの群の中から選ばれる材料で構成さ れたものが好ましい。セルロースの低級脂肪酸エステル における低級脂肪酸とは炭素原子数が6以下の脂肪酸を 意味し、セルロースアセテート、セルロースプロピオネ ート、セルロースプチレート等がセルロースの低級脂肪 酸エステルの好ましい例として挙げられる。その他に も、セルロースアセテートプロピオネートやセルロース アセテートブチレート等の混合脂肪酸エステルを用いる 10 ことが出来る。最も好ましいセルロースの低級脂肪酸工 ステルはセルローストリアセテートである。特に、酢化 度が59~62%のセルローストリアセテート(トリア セチルセルロース)である。すなわち、偏光板保護フィ ルムとして用いる場合には、酢化度が59~62%のセ ルローストリアセテート (トリアセチルセルロース)を

【0024】上記本発明における透明基材と反射防止層 との間に設けられる層は、金属アルコキシド又はその加 水分解物を主成分としたものを用いて構成されたものが 好ましい。すなわち、金属アルコキシド又はその加水分 解物を主成分としたものを用いて構成された層を透明基 材と反射防止層との間に設けておくことにより、反射防 止層の造膜性に優れ、かつ、膜強度も高まり、密着性が 向上し、更には反射率が大幅に低下する傾向があるから である。

用いて構成した透明基材であるのが好ましい。

[0025]

【発明の実施の形態】本発明になる反射防止剤は、一般 式(I), (II), (III), (IV), (V)で 表される含フッ素モノマーを二種類以上含み、このうち の少なくとも二種類の含フッ素モノマーは一般式

(I), (III), (III), (IV), (V)の異 なる群の中から選ばれたものである。特に、上記一般式 [I], [II], [III], [IV] の群の中から 選ばれた少なくとも一つの含フッ素モノマーと、上記一 般式(V)の群の中から選ばれた少なくとも一つの含フ ッ素モノマーとを含む。

【0026】本発明になる反射防止材は、透明基材に反 射防止層が設けられた反射防止材であって、前記反射防 止層は、上記反射防止剤を用いて構成されてなる。或い は、透明基材に反射防止層が設けられ、前記透明基材と 反射防止層との間に該反射防止層の屈折率よりも高い屈 折率の層が設けられた反射防止材であって、前記反射防 止層は、上記反射防止剤を用いて構成されてなる。又 は、透明基材に反射防止層が設けられ、前記透明基材と 反射防止層との間に該反射防止層の屈折率よりも高い屈 折率の高屈折率層が設けられ、前記透明基材と高屈折率 層との間に該反射防止層の屈折率よりも高いが高屈折率 層の屈折率よりも低い屈折率の中屈折率層が設けられた マーをも用いることによって、硬度が高まり、傷が付き 50 反射防止材であって、前記反射防止層は、上記反射防止

剤を用いて構成されてなる。

【0027】本発明になる偏光板保護フィルムは、上記反射防止材で構成されてなる。本発明になる偏光板は、上記反射防止材で構成されてなるフィルムが偏光子に貼り合わされてなる。本発明の反射防止剤における含フッ素モノマーは、好ましくは、該含フッ素モノマー中に含まれるフッ素原子が重量比で30~90wt%(特に、40wt%以上。80wt%以下。)のものである。

【0028】本発明における反射防止層は、好ましくは、上記した含フッ素モノマーの他に光重合モノマーを 10 も用いて構成される。又、光重合開始剤を用いて構成される。尚、上記反射防止層に含まれる上記の含フッ素モノマー成分は30wt%以上であることが好ましい。更に好ましくは60wt%以上である。特に好ましくは80wt%以上である。

【0029】本発明における透明基材は透明材料であれ ば良い。例えば、アセチルセルロース系樹脂、ポリエス テル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ノルボルネン系 樹脂、ポリアリレート系樹脂、ポリスルホン系樹脂など の透明有機樹脂が挙げられる。好ましくは、セルロース 20 の低級脂肪酸エステル(例えば、セルロースアセテー ト、セルロースプロピオネート、セルロースブチレー ト、セルロースアセテートプロピオネートやセルロース アセテートブチレート等) 及び一軸延伸ポリエチレンテ レフタレートの群の中から選ばれる材料で構成されたも のである。最も好ましいセルロースの低級脂肪酸エステ ルはセルローストリアセテートである。特に、酢化度が 59~62%のセルローストリアセテート(トリアセチ ルセルロース)である。偏光板保護フィルムとして用い る場合には、酢化度が59~62%のセルローストリア セテート(トリアセチルセルロース)を用いて構成した 透明基材である。

【0030】本発明における透明基材と反射防止層との間に設けられる層は、好ましくは、金属アルコキシド又はその加水分解物を主成分としたものを用いて構成される。又、上記金属アルコキシド等によって構成される層と透明基材との間に、好ましくは、ハードコート層が設けられる。以下、更に詳しく説明する。

【0031】上記一般式〔I〕で表される含フッ素モノマーとしては、例えば(メタ)アクリル酸-2,2,2ートリフルオロエチル、(メタ)アクリル酸-2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロピル、(メタ)アクリル酸-2,2,3,3,4,4,4-ペプタフルオロブチル、(メタ)アクリル酸-2,2,3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6-ウンデカフルオロペキシル、(メタ)アクリル酸-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-トリデカフルオロペプチル、(メタ)アクリル酸-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,

8,8-ペンタデカフルオロオクチル、(メタ)アクリ ル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ノナデカフル オロデシル、(メタ) アクリル酸-3,3,4,4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 1 0,10-ヘプタデカフルオロデシル、(メタ)アクリ ル酸-2-トリフルオロメチル-3,3,3-トリフル オロプロピル、(メタ) アクリル酸-3-トリフルオロ メチルー4,4,4ートリフルオロブチル、(メタ)ア クリル酸-1-メチル-2, 2, 3, 3, 3-ペンタフ ルオロプロピル、(メタ)アクリル酸-1-メチルー 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4ーヘプタフルオロブチル、 (メタ) アクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, -ヘキ サフルオロシクロブチル、(メタ)アクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロシクロペ ンチル、(メタ) アクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 - デカフルオロシクロヘキシル、 (メタ) アクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7ードデカフルオロシクロヘプチル、 (メタ) アクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8ーテトラデカフルオロシク ロオクチル、(メタ)アクリル酸-2-トリフルオロメ チルシクロブチル、(メタ)アクリル酸-3-トリフル オロメチルシクロブチル、(メタ)アクリル酸-2-ト リフルオロメチルシクロペンチル、(メタ) アクリル酸 -3-トリフルオロメチルシクロペンチル、(メタ)ア クリル酸-2-トリフルオロメチルシクロヘキシル、 (メタ) アクリル酸-3-トリフルオロメチルシクロへ キシル、(メタ) アクリル酸-4-トリフルオロメチル シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸-2-トリフルオ ロメチルシクロヘプチル、(メタ) アクリル酸-3-ト リフルオロメチルシクロヘプチル、(メタ) アクリル酸 - 4 - トリフルオロメチルシクロヘプチル等が挙げられ る。これらのモノマーは単独であっても、混合物であっ ても良い。尚、これらのモノマーは (メタ) アクリル酸 と含フッ素アルコールとのエステル化反応により得られ る。

【0032】上記一般式〔II〕で表される含フッ素モノマーとしては、例えばフマル酸ーisoープロピルー40 2, 2, 2ートリフルオロエチル、フマル酸ーisoープロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 4ーヘプタフルオロブチル、フマル酸ーisoープロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5ーノナフルオロペンチル、フマル酸ーisoープロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6ーウンデカフルオロペキシル、フマル酸ーisoープロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7ートリデカフルオロヘプチル、フマル酸ーisoープロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7ートリデカフルオロヘプチル、フマル酸ーisoープロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7

12

7、8、8、8 - ペンタデカフルオロオクチル、フマル 酸-iso-プロピル-3,3,4,4,5,5,6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル、 フマル酸-iso-プロピル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10,10-ノナデカフルオロデシル、フマル酸-is oープロピルー3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10ーヘプタデカフ ルオロデシル、フマル酸ーiso-プロピルー2ートリ フルオロメチルー3、3、3ートリフルオロプロピル、 フマル酸ーiso-プロピルー3-トリフルオロメチル -4, 4, 4-トリフルオロブチル、フマル酸-iso ープロピルー1ーメチルー2, 2, 3, 3, 3ーペンタ フルオロプロピル、フマル酸-iso-プロピル-1-メチル-2、2、3、3、4、4、4-ヘプタフルオロ ブチル、フマル酸ーtertープチルー2, 2, 2ート リフルオロエチル、フマル酸-tertープチル-2, 2, 3, 3, 3ーペンタフルオロプロピル、フマル酸tert-ブチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 4ーペン タフルオロブチル、フマル酸-tertープチルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 - ノナフルオロペンチ ル、フマル酸-tert-ブチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6 - ウンデカフルオロヘキシ ル、フマル酸-tert-ブチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7ートリデカフルオ ロヘプチル、フマル酸ーtert-ブチルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8 ーペンタデカフルオロオクチル、フマル酸ーtert-ブチルー3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル、フマル酸-t 30  $ert-\vec{\mathcal{I}}+\mathcal{I}-2$ , 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ノナデカフルオロデシル、フマル酸ーtert-ブチル -3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシ ル、フマル酸-tertープチル-2-トリフルオロメ チルー3,3,3ートリフルオロプロピル、フマル酸ー tert-プチルー3-トリフルオロメチルー4, 4, 4-トリフルオロブチル、フマル酸-tert-ブチル  $-1 - \lambda + \lambda + \lambda - 2$ , 2, 3, 3,  $3 - \alpha + \lambda + \lambda + \lambda = 0$ ロピル、フマル酸ーtertーブチルー1ーメチルー 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル、 フマル酸-iso-プロピル-2, 2, 3, 3, 4, 4 ーヘキサフルオロシクロプチル、フマル酸-iso-プ ロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5ーオクタフル オロシクロペンチル、フマル酸-iso-プロピルー 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 - デカフルオ ロシクロヘキシル、フマル酸-iso-プロピル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7ードデカ フルオロシクロヘプチル、フマル酸-iso-プロピル 50 m

-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8-テトラデカフルオロシクロオクチル、フマル酸 - i s o - プロピルー 2 - トリフルオロメチルシクロブ チル、フマル酸-iso-プロピル-3-トリフルオロ メチルシクロブチル、フマル酸-iso-プロピル-2 ートリフルオロメチルシクロペンチル、フマル酸-is o-プロピル-3-トリフルオロメチルシクロペンチ ル、フマル酸-iso-プロピル-2-トリフルオロメ チルシクロヘキシル、フマル酸-iso-プロピル-3 ートリフルオロメチルシクロヘキシル、フマル酸-is 0-プロピルー4ートリフルオロメチルシクロヘキシ ル、フマル酸ーiso-プロピルー2-トリフルオロメ チルシクロヘプチル、フマル酸-iso-プロピル-3 ートリフルオロメチルシクロヘプチル、フマル酸- i s 0-プロピルー4ートリフルオロメチルシクロヘプチ ル、フマル酸-ビス(2,2,2-トリフルオロエチ ル)、フマル酸-ビス(2, 2, 3, 3, 3-ペンタフ ルオロプロピル)、フマル酸-ビス(2,2,3,3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル)、フマル酸-ビス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5ーノナフルオロ ペンチル)、フマル酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6 - ウンデカフルオロヘキシ ル)、フマル酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7 – トリデカフルオロヘプチ ル)、フマル酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロ オクチル)、フマル酸-ビス(3,3,4,4,5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオ クチル)、フマル酸ービス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 1 0,10-ノナデカフルオロデシル)、フマル酸-ビス (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8,9, 9, 10, 10, 10 – ヘプタデカフルオロデシ ル)、或いはマレイン酸- i s o - プロピル-2, 2, 2-トリフルオロエチル、マレイン酸-iso-プロピ ルー2, 2, 3, 3, 3ーペンタフルオロプロピル、マ レイン酸-iso-プロピル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル、マレイン酸-iso-プロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5ーノナ フルオロペンチル、マレイン酸ーisoープロピルー 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6ーウンデ カフルオロヘキシル、マレイン酸-iso-プロピルー 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7 ートリデカフルオロヘプチル、マレイン酸-iso-プ ロピルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクチル、マ レイン酸-iso-プロピル-3,3,4,4,5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8 - トリデカフルオロオ クチル、マレイン酸-iso-プロピル-2,2,3,3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9,

20

9、10、10、10ーノナデカフルオロデシル、マレ イン酸-iso-プロピル-3,3,4,4,5,5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル、マレイン酸ーisoープロ ピルー2ートリフルオロメチルー3、3、3ートリフル オロプロピル、マレイン酸-iso-プロピル-3-ト リフルオロメチルー4,4,4ートリフルオロブチル、 マレイン酸ーisoープロピルー1ーメチルー2,2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル、マレイン酸-i 4. 4-ヘプタフルオロブチル、マレイン酸-tert ープチルー2,2,2ートリフルオロエチル、マレイン 酸-tert-ブチル-2, 2, 3, 3, 3-ペンタフ ルオロプロピル、マレイン酸-tert-ブチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロブチル、マレ イン酸-tert-ブチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチル、マレイン酸-t er t ーブチルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 6-ウンデカフルオロヘキシル、マレイン酸-te rtープチルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6.7.7.7ートリデカフルオロヘプチル、マレイン 酸-tert-ブチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロ オクチル、マレイン酸-tert-ブチル-3,3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8ートリデ カフルオロオクチル、マレイン酸ーtertーブチルー 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10ーノナデカフルオロ デシル、マレイン酸ーtertーブチルー3,3,4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10,10-ヘプタデカフルオロデシル、マレイン酸tertープチルー2ートリフルオロメチルー3,3, 3-トリフルオロプロピル、マレイン酸-tertーブ チルー3ートリフルオロメチルー4,4,4ートリフル オロブチル、マレイン酸-tert-ブチル-1-メチ ルー2, 2, 3, 3, 3ーペンタフルオロプロピル、マ レイン酸ーtertーブチルー1ーメチルー2,2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル、マレイン 酸-iso-プロピル-2, 2, 3, 3, 4, 4-へキ サフルオロシクロブチル、マレイン酸-iso-プロピ ルー2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5ーオクタフルオロ シクロペンチル、マレイン酸-iso-プロピル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6ーデカフルオロシ クロヘキシル、マレイン酸-iso-プロピル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7ードデカ フルオロシクロヘプチル、マレイン酸-iso-プロピ  $\mu$ -2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,8,8-テトラデカフルオロシクロオクチル、マレ イン酸-iso-プロピル-2-トリフルオロメチルシ クロプチル、マレイン酸ー i s o ープロピルー3ートリ 50 -

13

フルオロメチルシクロブチル、マレイン酸-iso-プ ロピルー2ートリフルオロメチルシクロペンチル、マレ イン酸ーiso-プロピルー3-トリフルオロメチルシ クロペンチル、マレイン酸ーiso-プロピルー2ート リフルオロメチルシクロヘキシル、マレイン酸-iso ープロピルー3ートリフルオロメチルシクロヘキシル、 マレイン酸-iso-プロピル-4-トリフルオロメチ ルシクロヘキシル、マレイン酸-iso-プロピル-2 - トリフルオロメチルシクロヘプチル、マレイン酸- i s o ープロピルー 3 ートリフルオロメチルシクロヘプチ ル、マレイン酸-iso-プロピル-4-トリフルオロ メチルシクロヘプチル、マレイン酸-ビス(2,2,2 ートリフルオロエチル)、マレイン酸ービス(2,2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピル)、マレイン酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブ チル)、マレイン酸ービス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチル)、マレイン酸-ビ ス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6ーウ ンデカフルオロヘキシル)、マレイン酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-1 リデカフルオロヘプチル)、マレイン酸ービス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8,8-ペンタデカフルオロオクチル)、マレイン酸-ピス (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8,8-トリデカフルオロオクチル)、マレイン酸-ビ ス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ノナデカフル オロデシル)、マレイン酸-ビス(3,3,4,4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 1 0,10-ヘプタデカフルオロデシル)等が挙げられ る。これらのモノマーは単独であっても、混合物であっ ても良い。尚、これらのモノマーはフマル酸またはマレ イン酸と含フッ素アルコールとのエステル化反応、又は 含フッ素カルボン酸とイソブテンとの反応による t e r tープチルエステルの導入反応とシスートランス異性化 反応とを組み合わせた方法により得られる。 【0033】上記一般式〔111〕で表される含フッ素 モノマーとしては、例えばイタコン酸-ビス(2, 2, 2-トリフルオロエチル)、イタコン酸ービス(2, 2.3.3.3ーペンタフルオロプロピル)、イタコン 酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオ ロブチル)、イタコン酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチル)、イタコン酸 ービス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6 ーウンデカフルオロヘキシル)、イタコン酸ービス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-トリデカフルオロヘプチル)、イタコン酸ービス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクチル)、イタコン 酸-ビス(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,

8.8.8-トリデカフルオクチル)、イタコン酸-ビ ス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ノナデカフル オロデシル)、イタコン酸-ビス(3,3,4,4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 1 0,10-ヘプタデカフルオロデシル)、イタコン酸-ビス(2-トリフルオロメチル-3,3,3-トリフル オロプロピル)、イタコン酸ービス(3ートリフルオロ メチルー4,4,4ートリフルオロブチル)、イタコン 酸-ビス(1-メチル-2, 2, 3, 3, 3-ペンタフ 10 ルオロプロピル)、イタコン酸-ビス(1 -メチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 4ーヘプタフルオロプチ ル)、イタコン酸-ビス(2,2,3,3,4,4,-ヘキサフルオロシクロブチル)、イタコン酸ービス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5ーオクタフルオロシ クロペンチル)、イタコン酸ービス(2,2,3,3, 4, 4, 5, 5, 6, 6ーデカフルオロシクロヘキシ ル)、イタコン酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7ードデカフルオロシクロヘプチ ル)、イタコン酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8ーテトラデカフルオロ シクロオクチル)、イタコン酸-ビス(2-トリフルオ ロメチルシクロブチル)、イタコン酸-ビス(3-トリ フルオロメチルシクロブチル)、イタコン酸-ビス(2 ートリフルオロメチルシクロブチル)、イタコン酸--ビ ス(3-トリフルオロメチルシクロプチル)、イタコン 酸-ビス(2-トリフルオロメチルシクロペンチル)、 イタコン酸ービス(3ートリフルオロメチルシクロペン チル)、イタコン酸ービス(2-トリフルオロメチルシ クロヘキシル)、イタコン酸-ビス(3-トリフルオロ 30 メチルシクロヘキシル)、イタコン酸ービス(4-トリ フルオロメチルシクロヘキシル)、イタコン酸ービス (2-トリフルオロメチルシクロヘプチル)、イタコン 酸-ビス(3-トリフルオロメチルシクロヘプチル)、 イタコン酸-ビス(4-トリフルオロメチルシクロヘプ チル)等が挙げられる。これらのモノマーは単独であっ ても、混合物であっても良い。尚、これらのモノマーは イタコン酸と含フッ素アルコールとのエステル化反応に より得られる。

【0034】上記一般式〔IV〕で表される含フッ素モ 40 ノマーとしては、例えばテトラヒドロフタル酸ービス (2, 2, 2ートリフルオロエチル)、テトラヒドロフタル酸ービス (2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 - ヘプタフルオロブチル)、テトラヒドロフタル酸ービス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5ーノナフルオロペンチル)、テトラヒドロフタル酸ービス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6 - ウンデカフルオロペキシル)、テトラヒドロフタル酸ービス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 50

7, 7ートリデカフルオロヘプチル)、テトラヒドロフ タル酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクチ ル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(3,3,4,4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオ クチル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(2,2,3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10ーノナデカフルオロデシル)、テ トラヒドロフタル酸ービス(3,3,4,4,5,5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(2-トリフルオロメチル-3, 3, 3-トリフル オロプロピル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(3-ト リフルオロメチルー4, 4, 4ートリフルオロブチ ル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(1-メチル-2. 2, 3, 3, 3ーペンタフルオロプロピル)、テトラヒ ドロフタル酸ービス(1-メチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチル)、テトラヒドロフ タル酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, -ヘキサフル 20 オロシクロブチル)、テトラヒドロフタル酸-ビス (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5ーオクタフルオロシ クロペンチル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6ーデカフルオロシ クロヘキシル)、テトラヒドロフタル酸ービス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7ードデカ フルオロシクロヘプチル)、テトラヒドロフタル酸-ビ ス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-テトラデカフルオロシクロオクチル)、テ トラヒドロフタル酸-ビス(2-トリフルオロメチルシ クロブチル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(3-トリ フルオロメチルシクロブチル)、テトラヒドロフタル酸 ービス(2ートリフルオロメチルシクロペンチル)、テ トラヒドロフタル酸-ビス(3-トリフルオロメチルシ クロペンチル)、テトラヒドロフタル酸ービス(2-ト リフルオロメチルシクロヘキシル)、テトラヒドロフタ ル酸-ビス(3-トリフルオロメチルシクロヘキシ ル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(4-トリフルオロ メチルシクロヘキシル)、テトラヒドロフタル酸ービス **(2-トリフルオロメチルシクロヘキシル)、テトラヒ** ドロフタル酸ービス(3ートリフルオロメチルシクロへ キシル)、テトラヒドロフタル酸-ビス(4-トリフル オロメチルシクロヘプチル)等が挙げられる。これらの モノマーは単独であっても、混合物であっても良い。 尚、これらのモノマーはテトラヒドロフタル酸と含フッ 素アルコールとのエステル化反応により得られる。 【0035】上記一般式〔V〕で表される含フッ素モノ マーとしては、例えばジ(メタ)アクリル酸-2,2, 2-トリフルオロエチルエチレングリコール、ジ(メ タ) アクリル酸-2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロ 50 プロピルエチレングリコール、ジ(メタ)アクリル酸-

2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロブチルエ チレングリコール、ジ(メタ)アクリル酸-2,2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ノナフルオロペンチルエ チレングリコール、ジ(メタ)アクリル酸-2,2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6 - ウンデカフルオ ロヘキシルエチレングリコール、ジ(メタ)アクリル酸 -2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7ートリデカフルオロヘプチルエチレングリコール、ジ (メタ) アクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. オクチルエチレングリコール、ジ(メタ)アクリル酸-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8 トリデカフルオロオクチルエチレングリコール、ジ (メタ) アクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 1 0-ノナデカフルオロデシルエチレングリコール、ジ (メタ) アクリル酸-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10ーヘプ タデカフルオロデシルエチレングリコール、ジ(メタ) アクリル酸-2-トリフルオロメチル-3,3,3-ト リフルオロプロピルエチレングリコール、ジ(メタ)ア クリル酸-3-トリフルオロメチル-4.4.4ートリ フルオロブチルエチレングリコール、ジ(メタ)アクリ ル酸-1-メチル-2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオ ロプロピルエチレングリコール、ジ(メタ)アクリル酸 -1-x+u-2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-x+v=1ルオロブチルエチレングリコール等が挙げられる。これ らのモノマーは単独であっても、混合物であっても良 い。尚、このようなジ(メタ)アクリル酸エステルは、 例えば相当する含フッ素エポキシと(メタ)アクリル酸 30 との通常の開環反応により得ることが出来るヒドロキシ (メタ) アクリル酸エステルと (メタ) アクリル酸との エステル化反応により得られる。

17

【0036】本発明の反射防止層を構成する為、上記含 フッ素モノマーと共に用いる光重合モノマーとしては、 例えばトリメチロールプロパントリアクリレート、ジト リメチロールプロパンテトラアクリレート、ペンタエリ スリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテ トラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアク リレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、アクリル変性ジペンタエリスリトールペンタエリス リトールが挙げられる。これらのモノマーは、硬化性が 大きく、収縮が小さく、低臭気性で低毒性であり、安全 性も比較的高い。

【0037】反射防止層を構成する為、上記含フッ素モ ノマー等と共に用いる光重合開始剤としては、例えばべ ンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチ ルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル等のベン ゾイン系化合物、ベンジル、ベンゾフェノン、アセトフ ェノン、ミヒラーズケトン等のカルボニル化合物、アゾ 50

ピスイソブチロニトリル、アゾジベンゾイル等のアゾ化 合物、αージケトンと三級アミンとの混合物などが挙げ られる。

【0038】上記モノマー等が溶解された溶液を透明基 材上に塗布し、光照射により重合を行わせることによっ て、本発明の反射防止層が形成される。用いる溶媒とし ては、例えばメタノール、エタノール、プロパノール、 ブタノール等のアルコール類、アセトン、メチルエチル ケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、ベンゼン、ト 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロ 10 ルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、エチレングリ コール、プロピレングリコール、ヘキシレングリコール 等のグリコール類、エチルセロソルブ、ブチルセロソル プ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、ジエチ ルセロソルブ、ジエチルカルビトール等のグリコールエ ーテル類、N-メチルピロリドン、ジメチルホルムアミ ド、1, 1, 2ートリクロロー1, 2, 2ートリフルオ ロエタン、トリフルオロメチルベンゼン、1, 4-ビス (トリフルオロメチル) ベンゼン等の有機溶剤、その他 水等が挙げられる。これらは単独でも、混合しても良 20 V

> 【0039】上記反射防止層は、反射率の観点から、そ の厚さが0.01~0.20μm (特に、0.03μm 以上。 0. 15 μ m以下) であるのが好ましい。 尚、 本 発明の反射防止層は、好ましくは、上記組成物を用いて 重合されたポリマーによって構成されたものである。し かし、それに限られるものでは無い。例えば、適宜なバ インダポリマー中に上記組成物を存在させた形態が考え られる。

> 【0040】透明基材と反射防止層(低屈折率層)との 間に設けられる層(反射防止層の屈折率よりも高い屈折 率の高屈折率層、透明基材と前記高屈折率層との間に反 射防止層の屈折率よりも高いが前記高屈折率層の屈折率 よりも低い屈折率の中屈折率層)は、金属アルコキシド 又はその加水分解物を主成分としたものを用いて構成さ れる。又、電離放射線樹脂のモノマー、ダイマー、オリ ゴマー等も用いて構成される。更には、Rin - Si Rz 〔但し、R」は、ビニル基、アリル  $(OR_3)_{4-n-8}$ 基、メタクリル基、エポキシ基、メルカプト基、シアノ 基、イソシアノ基、又はアミノ基である。R2R2は、 炭素数1~4の脂肪族炭化水素基である。nは1,2又 は3であり、mは0, 1又は2である。〕で表されるア ルコキシシラン等も用いて構成される。

> 【0041】金属アルコキシドとしては、A1、Si、 Ti, V, Zn, Sr, Y, Zr, In, Sn, Ta, W, Ti及びCeの群の中から選ばれた金属のアルコキ シドが挙げられる。好ましい金属は、A1、Si、T i, V, Zn, Y, Zr, In, Sn, Ta, W, Ce である。金属アルコキシドの具体例としては、例えばA 1 (OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, Al (OC<sub>2</sub> H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, Al (O $i - C_3 H_7$ ) 3, Al  $(O - n - C_4 H_9)$  3, Si

 $(OCH_3)_4$ , Si  $(OC_2H_5)_4$ , Si  $(O-i)_5$  $-C_3 H_7$ ), Si  $(O-t-C_4 H_9)$ , Ti (OCH<sub>3</sub>), Ti (OC<sub>2</sub> H<sub>5</sub>), Ti (O-n $-C_3 H_7$ ),  $T_i (O-i-C_3 H_7)$ ,  $T_i$  $(0-n-C_4 H_9)_4$ , Ti  $(0-i-C_3 H_7)_4$ の2~10量体、Ti (O-n-C, H, ), の2~1 O量体, VO (OC2 Hs) 3, Zn (OC 2 H<sub>5</sub> ) 2 , Y (OC<sub>1</sub> H<sub>2</sub> ) 3 , Zr (OC  $H_3$ ), Zr ( $OC_2$   $H_5$ ), Zr ( $O-n-C_2$  $H_{7}$ ),  $Z_{r}$   $(O-i-C_{3}$   $H_{7}$ ),  $Z_{r}$  (O-n) $-C_{4}H_{9}$ ),  $Zr(O-n-C_{4}H_{9})$ ,  $O2\sim 1$ O量体, In (OC+H<sub>9</sub>) 3, Sn (OC  $H_9$ ) A, Ta (OCH $_3$ ) A, Ta (O-n-C $_3$  $H_1$ ) s,  $Ta(O-i-C_3H_1)$  s, Ta(O-n-C<sub>4</sub> H<sub>9</sub> )<sub>5</sub>, W (OC<sub>2</sub> H<sub>5</sub> )<sub>6</sub>, Ce (OC<sub>3</sub> H 7) 3 等が挙げられる。中でも、Ti(O-n-C3 H  $_{7}$  ), Ti  $(O-i-C_{3}$  H<sub>7</sub> ), Ti (O-n- $C_4 H_9$ ),  $T_i (O-i-C_3 H_7)$ ,  $O_2 \sim 10$ 量体, Ti (O-n-C, H, ), の2~10量体, Z  $r (O-n-C_3 H_7)_4$ ,  $Z r (O-i-C_3 H_7)$ A,  $Z \Gamma$   $(O-n-C_4 H_9)_A$ , S i  $(O C_2 H_5)_A$ , Si (O-i-C<sub>3</sub> H<sub>7</sub>), は好ましいものであ る。そして、一種でも、二種以上のものを混合して用い てもよい。金属アルコキシドは加水分解されていてもよ い。例えば、酸性触媒または塩基性触媒の存在下に有機 溶媒中で加水分解することによって得られたものでもよ い。酸性触媒としては、硝酸や塩酸などの鉱酸、シュウ 酸や酢酸などの有機酸がある。塩基性触媒としてはアン モニア等が挙げられる。

【0042】金属アルコキシドによる層には、硬化促進や硬度向上を目的として、触媒や硬化剤が用いられる。例えば、金属キレート化合物、有機カルボン酸塩などの有機金属化合物や、アミノ基を有する有機ケイ素化合物、例えばUV照射により酸を発生する光酸発生剤などがある。金属アルコキシド又はその加水分解物を主成分とする塗料は、塗料の保存安定化の為に、 $\beta$ -ジケトンと反応させてキレート化合物とすることにより、安定な組成物とすることができる。 $\beta$ -ジケトンとしては、例えばアセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、アセト酢酸 1-プロピル、アセチルアセトン等が挙げられる。中でもアセト酢酸エチルは好ましいものである。

【0043】金属アルコキシド等と共に用いられる電離放射線樹脂のモノマー、ダイマー、オリゴマー等は、紫外線照射により架橋結合を形成するものが好ましいものとして挙げられる。すなわち、電離放射線樹脂としては、特に紫外線照射硬化型樹脂、例えば紫外線照射硬化型アクリルウレタン系樹脂、紫外線照射硬化型ポリエステルアクリレート系樹脂、紫外線照射硬化型ポリオールアクリレート系樹脂、紫外線照射硬化型ポリオールアクリ

レート系樹脂、紫外線照射硬化型エポキシ樹脂などが挙 げられる。紫外線照射硬化型アクリルウレタン系樹脂 は、一般に、ポリエステルポリオールにイソシアネート モノマー若しくはプレポリマーを反応させて得られた生 成物に、2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレートや 2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート等の水酸 基を有するアクリレート系のモノマーを反応させること によって得られる(特開昭59-151110号参 照)。紫外線照射硬化型ポリエステルアクリレート系樹 脂は、一般に、ポリエステルポリオールに2ーヒドロキ シエチル (メタ) アクリレートや2-ヒドロキシ (メ タ) アクリレート等のモノマーを反応させることによっ て得られる(特開昭59-151112号参照)。紫外 線照射硬化型エポキシアクリレート系樹脂は、エポキシ アクリレートのオリゴマー等を反応させることによって 得られる。紫外線照射硬化型ポリオールアクリレート系 樹脂は、トリメチロールプロパントリアクリレート、ジ トリメチロールプロパンテトラアクリレート、ペンタエ リスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトール テトラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタア クリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー ト等を反応させることによって得られる。

【0044】 $R_{10}$  —  $SiR_{22}$  ( $OR_3$ )  $\mu_{11}$  で表されるアルコキシシランの具体例としては、例えばピニルトリアルコキシシラン、アリルトリアルコキシシラン、 $\gamma$  —  $\gamma$  —  $\gamma$  →  $\gamma$ 

【0045】上記R<sub>In</sub> — SiR<sub>2</sub> (OR<sub>3</sub>) 4-ne おけるR<sub>1</sub> としては、紫外線照射硬化型樹脂のモノマー、ダイマー、オリゴマー等と架橋結合を形成する基が好ましい。なぜならば、R<sub>In</sub> — SiR<sub>2</sub> (OR<sub>3</sub>) 4-ne で表されるアルコキシシランは、金属アルコキシドと被膜中あるいは溶媒中で加水分解を経た後、金属アルコキシドから生成する金属酸化物マトリックス中に、脱水反応を経て、結合する。具体的には、金属原子一酸素一ケイ素ー酸素結合を形成する。更に、ケイ素は反応性基を有するので、紫外線照射硬化型樹脂のモノマー、ダイマー、オリゴマー等と結合することにより、金属アルコキシドから生成する金属酸化物マトリックスとケイ素原子を介して紫外線照射硬化型樹脂が結合した状態となる。言い換えれば、無機酸化物と有機ポリマーとが結合したハイ

20

30

40

ブリッド構造のものとなる。従って、一体化していることから、相分離が起き難く、均質な膜が出来やすく、白 濁したり、光透過率が低下する等の問題が解決される。

【0046】金属アルコキシド等による層は、上記組成 物を含む溶液を塗布し、硬化させることによって得られ る。用いる溶媒としては、例えばメタノール、エタノー ル、プロパノール、ブタノール等のアルコール類、アセ トン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケト ン類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水 素類、エチレングリコール、プロピレングリコール、ヘ キシレングリコール等のグリコール類、エチルセルソル ブ、ブチルセルソルブ、エチルカルビトール、ブチルカ ルビトール、ジエチルセルソルブ、ジエチルカルビトー ル等のグリコールエーテル類、N-メチルピロリドン、 ジメチルホルムアミド等の有機溶媒、その他にも水等が 挙げられる。これらは単独、又は二種以上を混合して使 用できる。尚、ケトン類、例えばアセトン、メチルエチ ルケトン、シクロヘキサノン等のカルボニル基を有する 溶媒と、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタ ノール等の炭素数が4以下のアルコールとを併用した場 合、硬化の為の紫外線照射量を低減でき、生産性が向上 したことから、好ましいものである。

【0047】上記高屈折率層や中屈折率層は、上記組成物を用いて構成できる。尚、同じ組成物を用いても、照射する紫外線量を制御することによって、屈折率の制御が出来る。例えば、照射紫外線量を多くした場合、高い屈折率の層となる。高屈折率層や中屈折率層を同系の組成物を用いて構成した場合、両層の密着性が高まり、好ましい。

【0048】上記高屈折率層は、反射率の観点から、屈 折率が1.75~2.20の範囲にあることが好ましい。又、その厚さは、反射率の観点から、0.01~0.20 $\mu$ m(特に、0.03 $\mu$ m以上。0.15 $\mu$ m以下)であるのが好ましい。又、中屈折率層は、反射率の観点から、屈折率が1.55~1.95の範囲にあることが好ましい。又、その厚さは、反射率の観点から、0.01~0.20 $\mu$ m(特に、0.03 $\mu$ m以上。0.15 $\mu$ m以下)であるのが好ましい。

【0049】上記ハードコート層は、紫外線や電子線のような電離放射線により架橋反応などを経て硬化させられたものが挙げられる。例えば、前述の電離放射線樹脂が挙げられる。中でも、紫外線照射硬化型ポリオールアクリレート系樹脂が好ましい。ハードコート層を構成する為、上記電離放射線樹脂のモノマー、ダイマー、オリゴマー等と共に、必要に応じて、光反応開始剤や光増感剤も用いられる。例えば、アセトフェノン、ベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、ミヒラーケトン、αーアミロキシムエステル、テトラメチルウラムモノスルファイド、チオキサントン及びこれらの誘導体などが用いられる。

【0050】ハードコート層は、低反射性の観点から、屈折率が $1.45\sim1.65$ の範囲にあることが好ましい。又、その膜厚は、耐久性、耐衝撃性、屈曲性、生産性の観点から、 $2\sim15\mu$  mの範囲にあることが好ましい。本発明の偏光板保護フィルムは、上記の反射防止材、特に厚さが $30\sim100\mu$  mの反射防止材で構成される。

【0051】反射防止材が偏光板保護フィルムである場 合、透明基材は、セルロースの低級脂肪酸エステルを主 成分としたフィルムであって、かつ、そのレタデーショ ン値が5~25nm (特に、8nm以上、更には10n m以上。20nm以下、更には15nm以下。)のもの が、特に、好ましい。レタデーション値については次の 通りである。透明樹脂フィルムに光を照射すると、当該 フィルム中を通過する光は、振動方向が互いに直交する 二方向の偏波に分かれて進む。この二方向の屈折率が異 なる為、光は当該フィルム中を進むにしたがってズレを 生じる。すなわち、当該フィルム中では二方向で光の伝 播速度が異なり、この時、当該フィルムから出る際の両 光の伝播距離の差をレタデーション値と言う。レタデー ション値の単位は、通常、nmで表される。本明細書で は、レタデーション値の測定には、自動複屈折計KOB RA-21DH(КSシステムズ(株)製)を用いて、 23℃、55%RHの環境下において、波長が590n mの光を照射することにより行ったものである。

【0052】レタデーション値が5~25nmのフィル ムの製造方法について、セルロースの低級脂肪酸エステ ルを主成分、特にアセチルセルロースを主成分とした場 合で説明する。アセチルセルロースをメチレンクロライ ド、エタノール、アセトン、メタノール等の有機溶媒に 溶解してドープを形成する。ドープ中のアセチルセルロ ースの濃度は10~35wt%程度である。尚、これに フタル酸エステル、リン酸エステル等の可塑剤をアセチ ルセルロースに対して3~20wt%添加してもよい。 更に、必要に応じて、紫外線吸収剤、滑剤などの添加剤 を加えてもよい。そして、得られたドープを支持体上に 流延し、製膜する。製膜方法としてはバンド法やドラム 法を用いることが出来る。次に、このようにして得られ たフィルムを支持体から剥ぎ取る。特に、フィルム中の 有機溶媒がある程度含まれている状態、例えば10~6 Owt%の状態で剥ぎ取り、しかもフィルムを縦方向に 対して通常よりも強い張力で剥ぎ取り、乾燥時間を適度 に設定して乾燥する。縦方向の張力をより強く掛ける場 合、横方向の寸法を固定した状態で乾燥することが好ま しい。横方向の寸法を固定した状態では、有機溶媒が2 0wt%未満の残留量まで乾燥するのが好ましい。

【0053】セルロースの低級脂肪酸エステルにおける 低級脂肪酸とは炭素原子数が6以下の脂肪酸を意味し、 セルロースアセテート、セルロースプロピオネート、セ 50 ルロースブチレート等がセルロースの低級脂肪酸エステ ルの好ましい例として挙げられる。その他にも、セルロ ースアセテートプロピオネートやセルロースアセテート ブチレート等の混合脂肪酸エステルを用いることが出来 る。最も好ましいセルロースの低級脂肪酸エステルはセ ルローストリアセテートである。特に、酢化度が59~ 62%のセルローストリアセテート(トリアセチルセル ロース) である。

【0054】すなわち、上記セルロースの低級脂肪酸工 ステル、特にトリアセチルセルロースを主成分としたも のを用いて上記した溶液流延法によりフィルムを作成 し、そして剥ぎ取り張力を強くすることによって、レタ デーション値が5~25nm(特に、8nm以上、更に は10 n m以上。20 n m以下、更には15 n m以 下。) の透明基材が得られる。

【0055】そして、上記偏光板保護フィルムを偏光子 に貼り合わすことによって本発明の偏光板が得られる。 偏光板保護フィルムが積層される偏光子は、例えばポリ ビニルアルコール製のフィルムを沃素の如きの二色性染 料で処理して延伸することにより得られる。偏光子の厚\* \* さは50~150 μ m である。

【0056】そして、本発明の偏光板保護フィルムが用 いられた偏光板を採用したLCDは、偏光板保護フィル ムが傷付き難く、耐久性に富んでおり、かつ、偏光板保 護フィルム表面の反射防止層の均質性に優れ、かつ、反 射防止効果に優れており、外光の映り込みが防止され、 視野角も広く、そして光透過率は高いことから、視認性 に優れたものである。

24

[0057]

10 【実施例1】透明基材として酢化度が61.0%のセル ローストリアセテートフィルム(コニカ(株)製のコニ カタック80UVSH、厚さ80μm)を用いた。この セルローストリアセテートフィルムの一面に下記の紫外 線硬化型樹脂組成物Aを塗布し、80℃で5分間乾燥さ せた。次いで、80W/cm<sup>2</sup> 高圧水銀灯を12cmの 距離から4秒間照射して硬化させ、ハードコート層を設 けた。尚、ハードコート層の厚さは3.5μmであっ た。

[0058]

〔紫外線硬化型樹脂組成物 A〕

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート単量体 60重量部 ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート2量体 20重量部 ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート3量体以上の成分 20重量部 ジエトキシベンゾフェノンUV開始剤 2重量部 シリコーン系界面活性剤 1重量部 アエロジルR-972 (日本アエロジル (株) 製) 1重量部 メチルエチルケトン 50重量部 酢酸エチル 50重量部 イソプロピルアルコール 50重量部

\*上記組成物を攪拌しながら、超音波分散した。

【0059】次に、上記ハードコート層上に下記の低屈 折率層用組成物 Dを塗布し、80℃で2分間乾燥させ た。次いで、3kwの高圧水銀灯を25cmの距離から※

※10秒間照射して硬化させ、低屈折率層を設けた。尚、 低屈折率層の厚さは80 nmで、屈折率は1.37であ った。

〔フッ素含有モノマー組成物(低屈折率層用組成物)D〕

メタクリル酸-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-オクタフルオロヘキシル (H(CF<sub>2</sub>), CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> OOC(CH<sub>3</sub>)=CH<sub>2</sub>. 以下、F-1) 45重量部 ジアクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 , 9, 9, 9 – ヘプタデカフルオロノニルエチレングリコール(F(CF₂)₃ CH₂ C H(00CH=CH₂)CH₂00CH=CH₂), 以下、F-2) 45重量部

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート(光重合性モノマー)

10重量部 ジエトキシベンゾフェノン (重合開始剤) 0.2重量部 界面活性剤(大日本インキ社製のF-177) 1 重量部 シクロヘキサノン 3500重量部 イソプロピルアルコール 7700重量部

[0060]

【実施例2】実施例1において、F-1の代わりに下記 の (化10) で表される化合物 (以下、F-3) を用い た以外は同様に行った。

【化10】

CH2=CCOOCH2CH2 (CF2) 4F CH2COOCH2CH2 (CF2) 4F

[0061]

[0062] 50

25

【実施例3】実施例1において、F-1の代わりに下記の(化11)で表される化合物(以下、F-4)を用い、かつ、F-2の代わりに( $CF_3$ ) $_2$   $CF(CF_2)$  $_3$   $CH_4$   $CH(OOCH=CH_4$ )  $CH_4$   $OOCH=CH_4$  (以下、F-5) を用いた以外は同様に行った。

### [0063]

## 【化11】

## [0064]

【実施例4】実施例3において、45重量部のF-4の代わりに30重量部のF-1と20重量部のF-6(F( $CF_2$ )<sub>10</sub>  $CH_2$   $CH_3$   $COCCH=CH_4$ )とを用い、又、F-5を40重量部とし、かつ、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの代わりにペンタエリスリトールテトラアクリレートを用いた以外は同様に行った。

#### [0065]

【実施例5】実施例3において、45重量部のF-4の代わりに20重量部のF-3と20重量部のF-7(F( $CF_2$ )。( $CH_2$ )。00CCH=CHCO0( $CH_2$ )。( $CF_2$ )。F)とを用い、かつ、F-5を50重量部とした以外は同様に行った。

## [0066]

【実施例6】実施例1において、F-2の代わりにF-8 ((CF<sub>2</sub>), CF(CF<sub>2</sub>), CH, CH(OH) CH, OOCC(CH, )=CH, ) を用い、かつ、ジペンタエリスリトールへキサアクリレートの代わりにペンタエリスリトールテトラアクリレートを\*

\*用いた以外は同様に行った。

### [0067]

【実施例7】実施例1において、F-2の代わりにF-7を用いた以外は同様に行った。

#### [0068]

【実施例8】実施例2において、F-2の代わりにF-4を用いた以外は同様に行った。

#### [0069]

【実施例9】実施例2において、F-2の代わりにF-10 7を用いた以外は同様に行った。

#### [0070]

【比較例1】実施例1において、F-1を90重量部、F-2を0重量部とした以外は同様に行った。

## [0071]

【比較例2】実施例1において、F-1を0重量部、F-2を90重量部とした以外は同様に行った。

### [0072]

【比較例3】実施例1において、45重量部のF-1の代わりに90重量部のF-7を用い、F-2を0重量部20 とし、かつ、ジペンタエリスリトールへキサアクリレートの代わりにペンタエリスリトールテトラアクリレートを用いた以外は同様に行った。

#### [0073]

【特性】上記各例で得たフィルムについて、低屈折率層の屈折率、及びその密着性、並びに耐磨耗性を調べたので、その結果を表-1に示す。

		表-1	
	屈折率	密着性	耐磨耗性
実施例1	1. 37	100/100	0
実施例2	1. 37	100/100	0
実施例3	1.39	100/100	0
実施例 4	1. 37	100/100	0
実施例 5	1. 38	100/100	0
実施例6	1.39	90/100	0
実施例7	1. 38	85/100	0
実施例8	1.40	90/100	0
実施例9	1.40	85/100	0
比較例1	1.41	55/100	×
比較例 2	1.40	60/100	$\triangle$
比較例3	1.40	55/100	×

屈折率や膜厚は、分光光度計(日立製作所製U-4000型)による分光反射率の測定値より計算して求めたものである。すなわち、低屈折率層が設けられていない側のセルローストリアセテートフィルムの裏面を粗面化した後、黒色のスプレーを用いて光吸収処理を行い、フィルム裏面での光の反射を防止し、反射率の測定を5度正反射の条件にて行ったものである。

【0074】密着性はJIS K 5400に準拠した 碁盤目試験による。具体的には、高屈折率層面上に1m 50

m間隔で縦、横に11本の切れ目を入れ、1mm角の碁盤目を100個つくり、この上にセロハンテープを貼り付け、90度の角度で素早く剥がし、剥がれずに残っている碁盤目の数で表示した。耐磨耗性は#0000のスチールウールに1cm²当たり0.1kgの荷重を掛けて表面を10往復した後のスチールウール往復方向1cm幅当たりの傷の具合を黙視で評価した。○印は傷が全く認められず、△印は傷が弱く認められ、×印は傷が強く認められたである。

28

【0075】これによれば、本発明になるフィルムは、 傷付きが起き難く、耐久性に富み、かつ、ベースフィル ムに対する密着性が高いことが判る。

#### [0076]

【実施例 10 】透明基材として酢化度が 61.0 %のセルローストリアセテートフィルム (コニカ (株) 製のコニカタック 80 U V S F 、厚さ 80  $\mu$  m) を用いた。こ\*

\*のセルローストリアセテートフィルム5の一面に下記の 紫外線硬化型樹脂組成物Aを塗布し、80℃で5分間乾燥させた。次いで、3kwの高圧水銀灯を25cmの距離から10秒間照射して硬化させ、ハードコート層6を 設けた。尚、ハードコート層6の厚さは3 $\mu$ mであり、 その屈折率は1.52であった。

## [0077]

## 〔紫外線硬化型樹脂組成物 A〕

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート単量体 60重量部 ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート2量体 20重量部 ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート3量体以上の成分 20重量部 ジエトキシベンゾフェノンUV開始剤 2重量部 シリコーン系界面活性剤 1重量部 アエロジルR-972 (日本アエロジル (株) 製) 1重量部 メチルエチルケトン 50重量部 酢酸エチル 50重量部 イソプロピルアルコール 50重量部

\*上記組成物を攪拌しながら、超音波分散した。

【0078】次に、ハードコート層6上に下記の中屈折 ※10秒間照射して硬化させ、中屈折率層7を設けた。 率層用組成物Bを塗布し、80℃で30分間乾燥させ 20 尚、中屈折率層7の厚さは80nmで、屈折率は1.6 た。次いで、3kwの高圧水銀灯を25cmの距離から※ 6であった。

### 〔中屈折率層用組成物 B〕

チタニウムテトラーnープトキシド30重量部ジエトキシベンゾフェノンUV開始剤0.1重量部yーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン5重量部シクロヘキサノン1400重量部イソプロピルアルコール3500重量部

次に、中屈折率層7上に下記の高屈折率層用組成物 Cを ★させ、高屈折率層 8 を設けた。尚、高屈折率層 8 の厚さ 塗布し、80 ℃で5分間乾燥させた。次いで、3 k wの は85 n mで、屈折率は1.90であった。 高圧水銀灯を25 c mの距離から10秒間照射して硬化★30 【0079】

## [高屈折率層用組成物 C]

チタニウムテトラー n ー ブトキシド75重量部テトラエトキシシラン8.3重量部界面活性剤(大日本インキ社製のF-177)1重量部シクロヘキサノン2500重量部トルエン5700重量部

この後、高屈折率層 8 上に下記のフッ素含有モノマー組 ☆ して硬化させ、低屈折率層 9 を設けた。尚、低屈折率層 成物 D を塗布し、80℃で2分間乾燥させた。次いで、 9 の厚さは90 n m で、屈折率は1.37であった。 3 k w の高圧水銀灯を25 c m の距離から10秒間照射☆ 【0080】

### 〔フッ素含有モノマー組成物(低屈折率層用組成物)D〕

メタクリル酸-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-オクタフルオロヘキシル

45重量部

ジアクリル酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9 - ヘプタデカフルオロノニルエチレングリコール 45重量部 ジペンタエリスリトールへキサアクリレート (光重合性モノマー)

10重量部

ジエトキシベンゾフェノン(重合開始剤)0.2重量部界面活性剤(大日本インキ社製のF-177)1重量部シクロヘキサノン3500重量部イソプロピルアルコール7700重量部

上記のようにしてセルローストリアセテートフィルム5 -ハードコート層6-中屈折率層7-高屈折率層8-低 屈折率層9からなる偏光板保護フィルムを得た。

【0081】そして、この偏光板保護フィルムの反射率を測定した処、反射率は0.2%であり、大きな反射防止効果が認められた。又、このものは、密着性に優れ、かつ、傷付きが起き難く、耐磨耗性に富むことが、実施例1の結果から判る。

## [0082]

【発明の効果】密着性に優れ、かつ、傷付きが起き難く、耐磨耗性に富む材料である。又、密着性に優れ、かつ、傷付きが起き難く、耐磨耗性に富み、更には反射率が低く、例えば偏光板保護フィルムとして用いた場合に\*

\*は、外光の映り込みが防止され、その結果、視野角も拡がり、そして光透過率も高く、優れた偏光板が得られる。

【図面の簡単な説明】

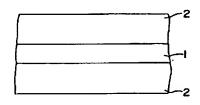
【図1】偏光板の概略図

【図2】偏光板保護フィルムの概略図

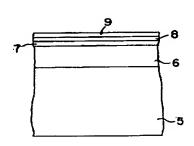
【符号の説明】

- 5 セルローストリアセテートフィルム(透明基材)
- 6 ハードコート層
- 10 7 中屈折率層
  - 8 高屈折率層
  - 9 低屈折率層(反射防止層)









## フロントページの続き

(51) Int. Cl. "	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C O 8 F 222/	<sup>′</sup> 18	C O 8 F 222/18	
232/	/04	232/04	
G O 2 B 1/	′10	G O 2 B 5/30	
5/	/30	1/10	Z

(72)発明者 小林 徹

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式

会社内

(72)発明者 長谷川 光世

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式

会社内

F ターム(参考) 2H049 BA02 BB22 BB23 BB28 BB44 BB46 BB49 BB54

2K009 AA02 AA15 BB24 BB28 CC02 CC24 CC26 CC34 DD15 FF03

4F100 AH08C AH08D AJ06A AK17 AK17B AK25 AK42A AT00A BA04 BA10A BA10B CA02 CA18 EJ37A EJ54 GB41 JB14B JK12 JL01 JL06 JN01A JN06B JN18B JN18C JN18D

4J011 CA01 CA08 CC10 QA03 QA08 QA32 QA35 SA02 SA22 SA32 SA34 SA42 SA79 UA01 VA01 WA10

4J100 AL08P AL39P AL46P AL63Q AL66P AL66Q AR05P BA03Q BA20P BB07P BB18P BC02P BC03P BC04P CA04 CA05 CA06 DA63 JA32